

## 專利局動態

### [韓國]

#### 韓國專利局擴展取得標準專利之計畫

韓國專利局日前宣布 2017 年運作推廣計畫，該計畫是為了促進標準專利之生成，協助擁有於核心領域中，涉及第四代工業革命之優良技術的小型與中型企業、大學與公眾機構，以便在全球市場中，於取得標準專利上有大躍進。事實上，韓國專利局自 2010 年起便開始執行促進標準專利之生成這項計畫，並以一群專門團隊分析有關韓國企業與機構的技術之國際標準與專利，以利於擬定取得標準專利策略。據統計，在韓國於 2011 年的標準專利僅有 300 件，但到了 2016 年增加到 824 件，約為 2.7 倍的成長，至於持有標準專利的韓國企業或機構從 14 家增加到 24 家。

資料來源：“KIPO expands support for securing a standard patent which is a key of the fourth industrial revolution,” Kim Hong Associate Newsletter No.353. 2017 年 2 月 1 日。

<<http://www.pkkim.com/resources/new.asp?LetterNum=338&Page=1&bType=A>>

### [歐洲]

#### 歐洲專利局延長「檢索策略資訊 (Information on Search Strategy)」計畫

歐洲專利局係自 2015 年 11 月 1 日起，實施於檢索報告附上名為「檢索策略資訊」的附件，提供申請人針對該案進行之檢索相關資訊。此項實務是為測試所提供之資訊對於申請人和第三人是否有所助益，屆時會決定是否於 2017 年全面施行或延長試行期間；「檢索策略資訊」的內容僅作為參考資訊，歐洲專利局將自動發出，申請人無須提出請求。

歐洲專利局表示自 2017 年 1 月 1 日起，將再延長此試行計畫 12 個月。

資料來源：“Extension of the pilot programme on search strategies,” EPO. 2017 年 1 月 31 日。

<<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2017/01/a3/2017-a3.pdf>>

#### Global Patent Index (GPI) 資料庫新增提供全文文件功能

GPI 資料庫為歐洲專利局提供之線上檢索工具，使用 GPI 資料庫須登錄並付費，但使用者也可先選擇免費試用 2 個月。使用者進行檢索後，可依個人需要選擇顯示出的資料種類。

歐洲專利局日前宣布，現 GPI 資料庫提供專利全文文件，並可顯示於 GPI 的資料庫。以下為進行檢索後，顯於全文選擇出的申請練範圍與對應圖式的範例：

The screenshot displays the EPO Global Patent Index (GPI) interface. The top navigation bar includes 'Preferences', 'Download', 'Print', 'Help', 'Search', 'Result', 'Statistics', and 'Log out'. The document title is 'WO 2016046735 A1 20160331'. The 'Claims' tab is active, showing the following text:

CLAIMS

1. Laser source, for use particularly for industrial processes, comprising:

- a laser beam generating unit (2), including one or more diode laser sources (20), for generating a first laser beam,
- an optical amplification unit (6) including at least one amplifier module (60) adapted to be pumped with laser light derived from said first laser beam emitted by said generating unit (2) and to emit a second laser beam at its output which is characterized by a higher beam quality and a lower power value with respect to said first laser beam at the output from said generating unit (1), and
- a laser beam shifting and addressing optical unit (4), interposed between said generating unit (2) and said optical amplification unit (6), said laser beam shifting and

To the right of the text is a technical drawing labeled 'FIG. 1'. The drawing shows a schematic of a laser system with various components labeled with numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. The drawing illustrates the optical path and the arrangement of the laser sources, amplification unit, and beam shifting unit.

資料來源：“Display of full-text documents in Global Patent Index(GPI),” EPO.  
2017年1月25日。

<<https://www.epo.org/service-support/updates/2017/20170125.html>>